

題號： 182

國立臺灣大學103學年度碩士班招生考試試題

科目：活動義齒學

節次： 4

題號：182

共 1 頁之第 1 頁

1. 請簡述上顎(maxilla)與下顎(mandible)主要受力區(primary stress bearing area)、次要受力區(secondary stress bearing area)、緩壓區(relief area)、valve seal area的部位。(10%)
2. 請簡單說明臨床製作全口活動義齒時，有哪些方法可以用來紀錄顎間的垂直距離(vertical dimension)。(10%)
3. 請說明全口義齒製作時，clinical remount的使用時機，並簡述操作步驟？(10%)
4. 請說明 neutral zone 在製作全口義齒的臨床意義，並簡述操作此技術的材料及方法。(10%)
5. 請說明製作 single denture 時(對側是 natural dentition 或 partial denture)常出現的臨床問題，及 prosthesis 設計的注意事項。(10%)
6. 請說明 reline distal extension RPD 之時機與方法。(15%)
7. 請說明 distal extension RPD 設計中，你對 clasp 選擇之考量。(10%)
8. 近年來，牙根植體慢慢被應用於局部活動義齒的設計中，你會如何利用牙根植體於活動義齒的設計。(10%)
9. 使用 wrought wire clasp 的優缺點，如何將 wrought wire 加在局部活動義齒以及 wrought wire 的選擇。(15%)

試題隨卷繳回